

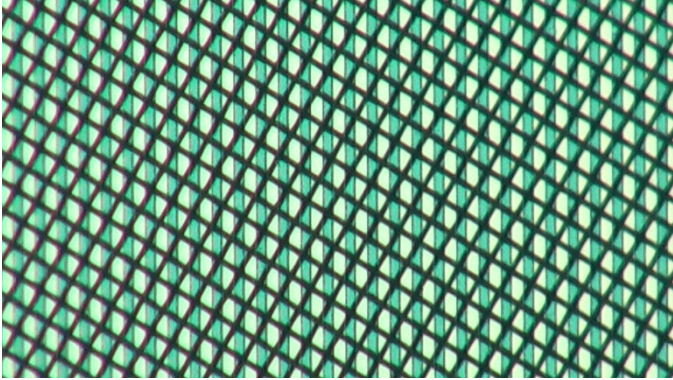
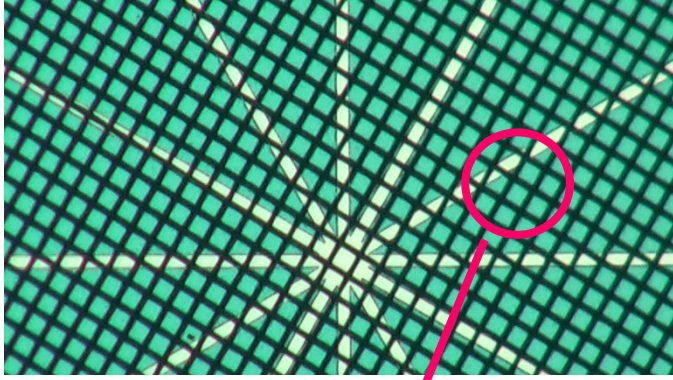
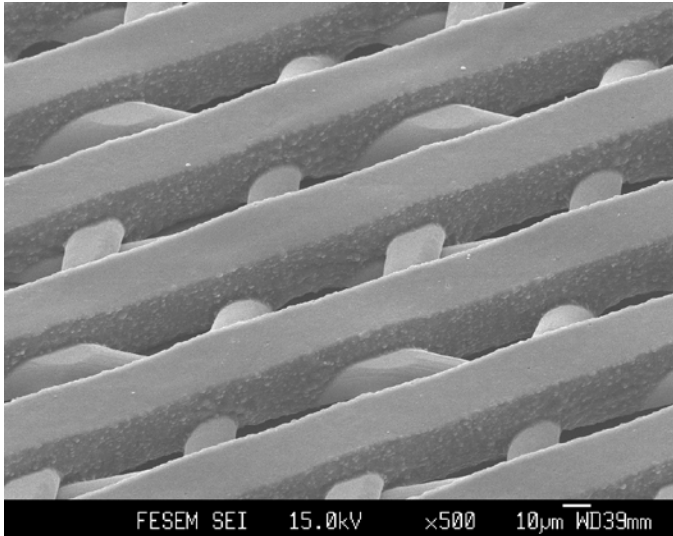
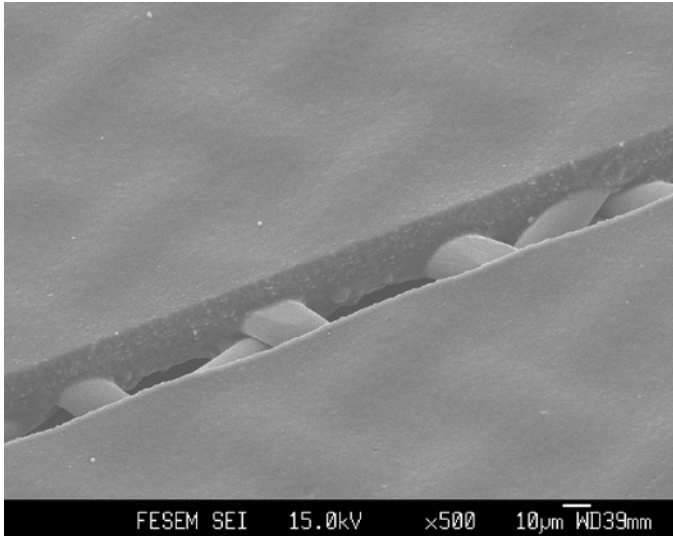
直接描画装置による製版(L／S:30 μ)

1. 直接描画装置－目的

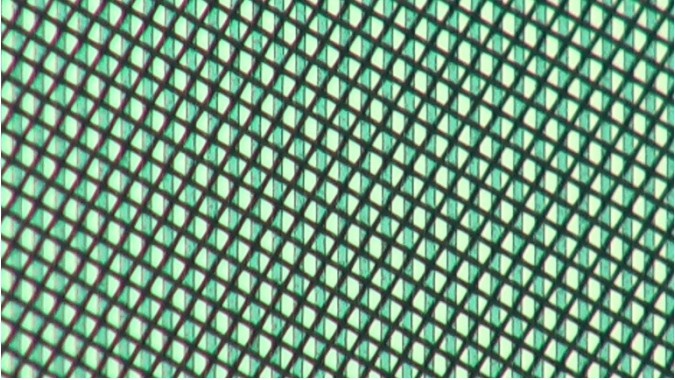
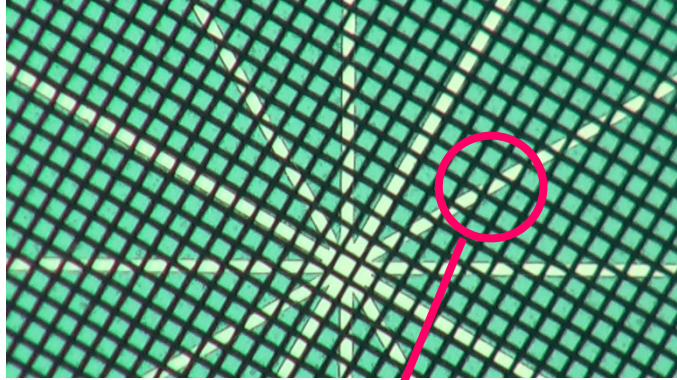
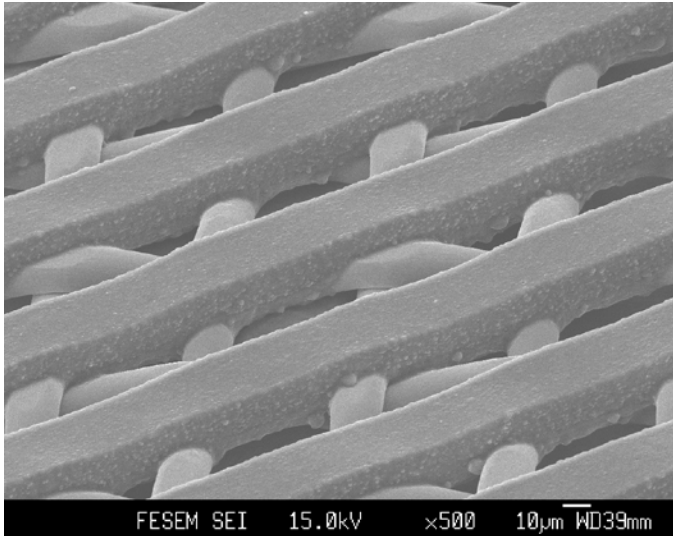
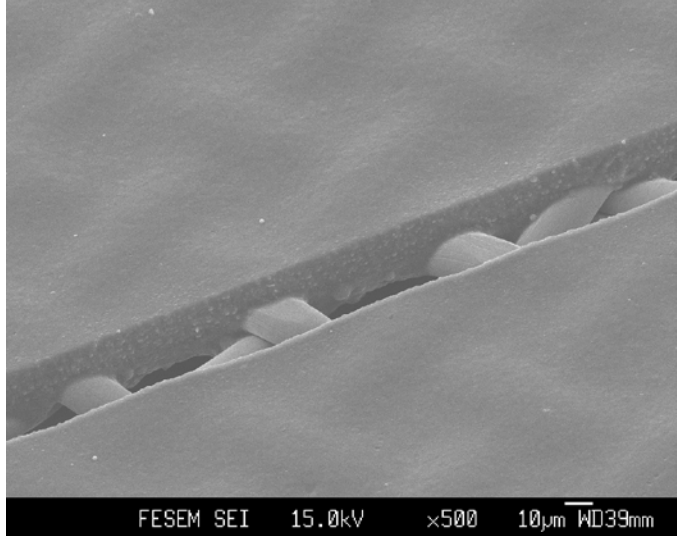
目的

- 電子業界で幅広く使用されている直接描画装置は近い将来にはスクリーン製版の製法に使用され则认为しております。
当社としても、直接描画装置によるスクリーン製版の製法にいち早く対応して乳剤開発・技術向上も含めて取り組んでおります。

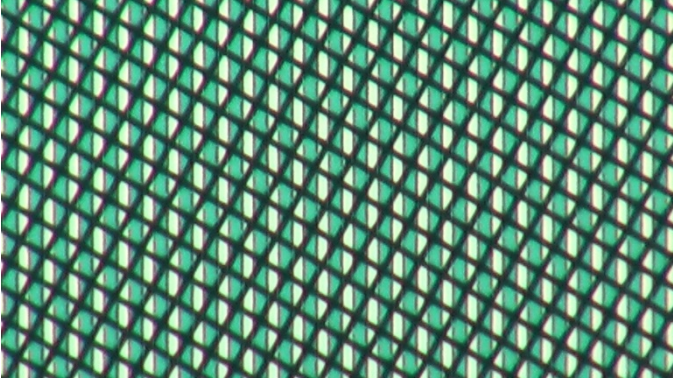
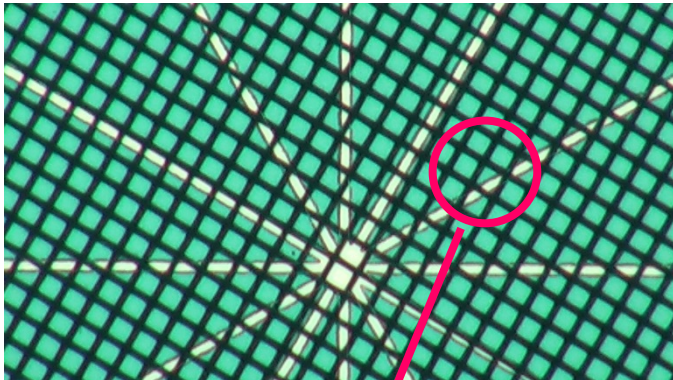
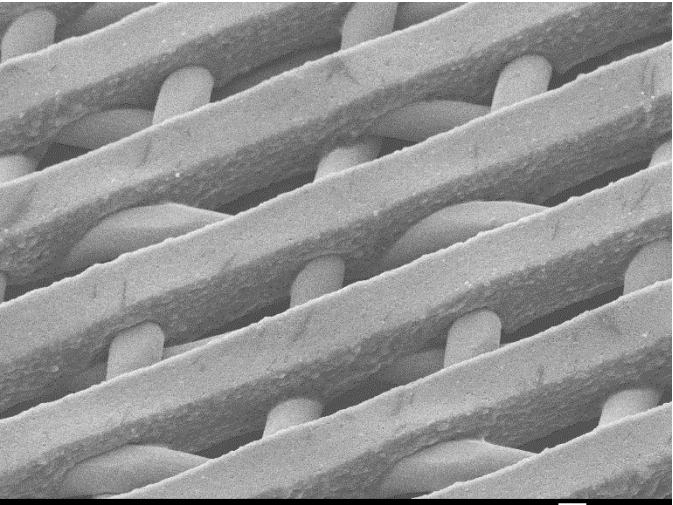
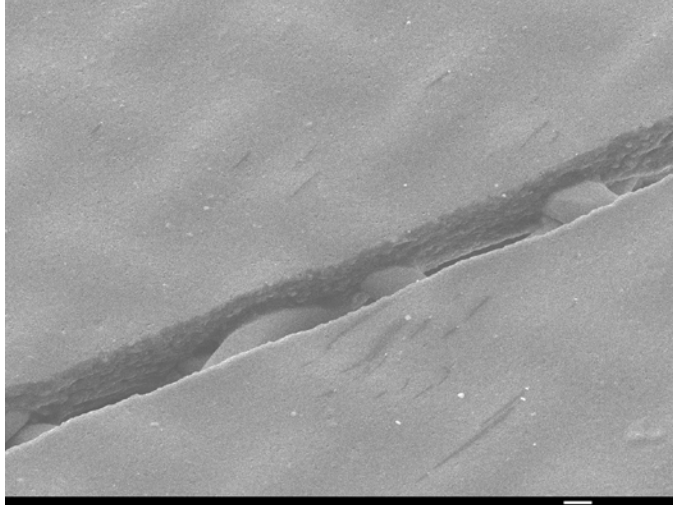
2. 直接描画装置－①乳剂

30μ L/S		30μ 斜線	
SEM	 FESEM SEI 15.0kV ×500 10μm WD39mm	SEM	 FESEM SEI 15.0kV ×500 10μm WD39mm

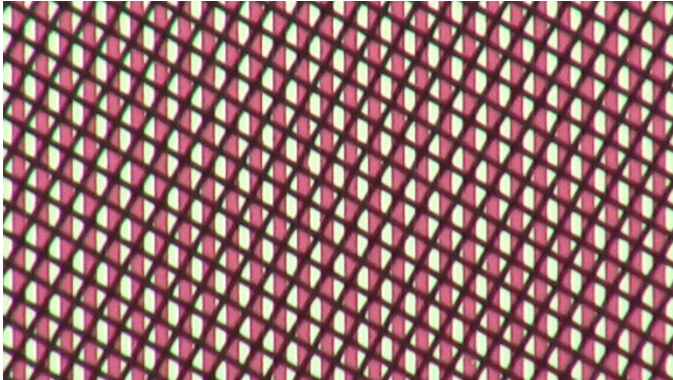
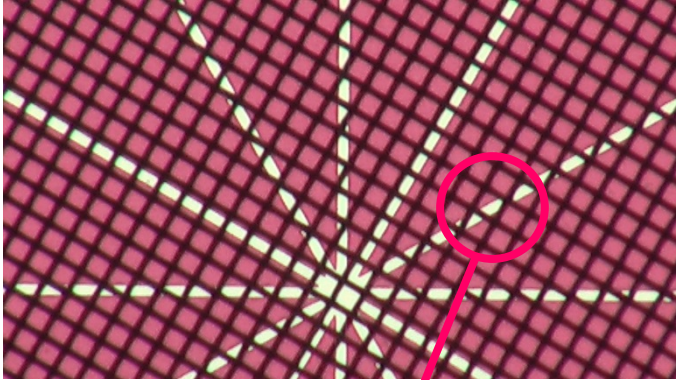
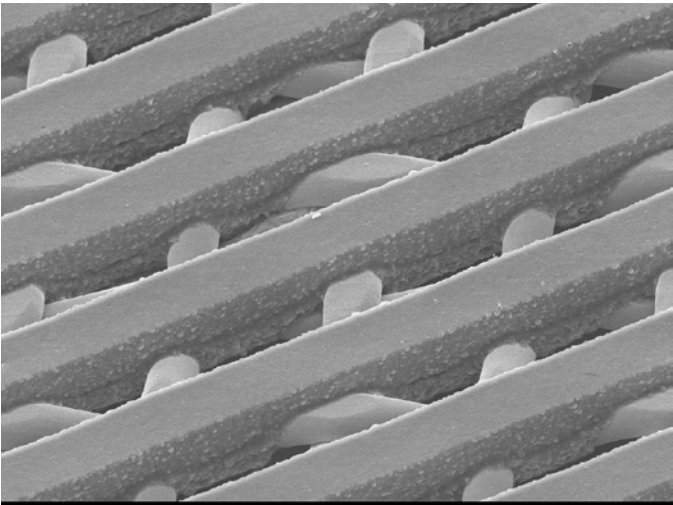
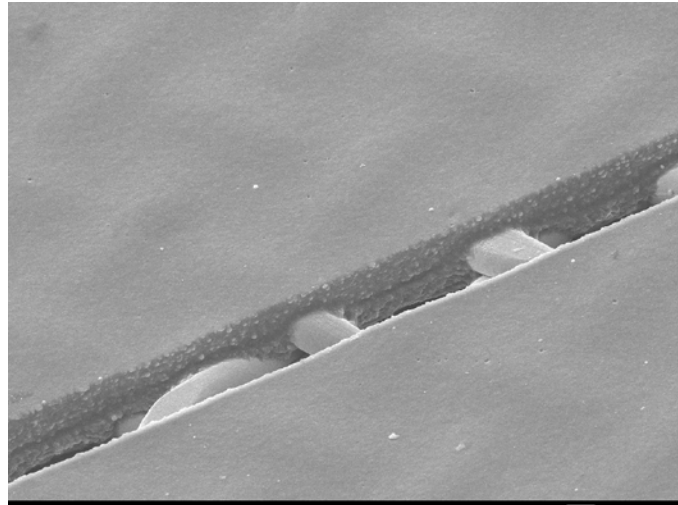
2. 直接描画装置－①乳剤の密着力アップ乳剤

30μ L/S		30μ 斜線	
SEM	 FESEM SEI 15.0kV ×500 10μm WD39mm	SEM	 FESEM SEI 15.0kV ×500 10μm WD39mm

2. 直接描画装置－②乳剂

30μ L/S		30μ 斜線	
SEM	 FESEM SEI 15.0kV x500 10μm WD39mm	SEM	 FESEM SEI 15.0kV x500 10μm WD39mm

2. 直接描画装置－③直描用乳剂(PAT乳剂)

30μ L/S		30μ 斜線	
SEM		SEM	

3. 直接描画装置－まとめ

- 各直接描画装置メーカー様とテストを行ない乳剤で改善できる点もあります。
たとえば、①解像性(テーパー)の改善(弊社PAT乳剤) ②ラチュード幅を大幅に広げる などオリジナル乳剤も準備しております。

直接描画装置用乳剤に関しては弊社まで、お問い合わせください。

- ◆50 μ のL/Sから今回、30 μ のL/Sを掲載させていただきます。
20 μ のL/Sも準備中です。
近日中に掲載致します。